

New Multi-Functional Micro- And Nanoimprint Solution From EV GROUP Offers Unprecedented Flexibility For High-Volume Optical Device Manufacturing – January 19, 2022

EV GROUP全新多功能微米及奈米壓印解決方案，為量產的光學裝置提供前所未有的彈性

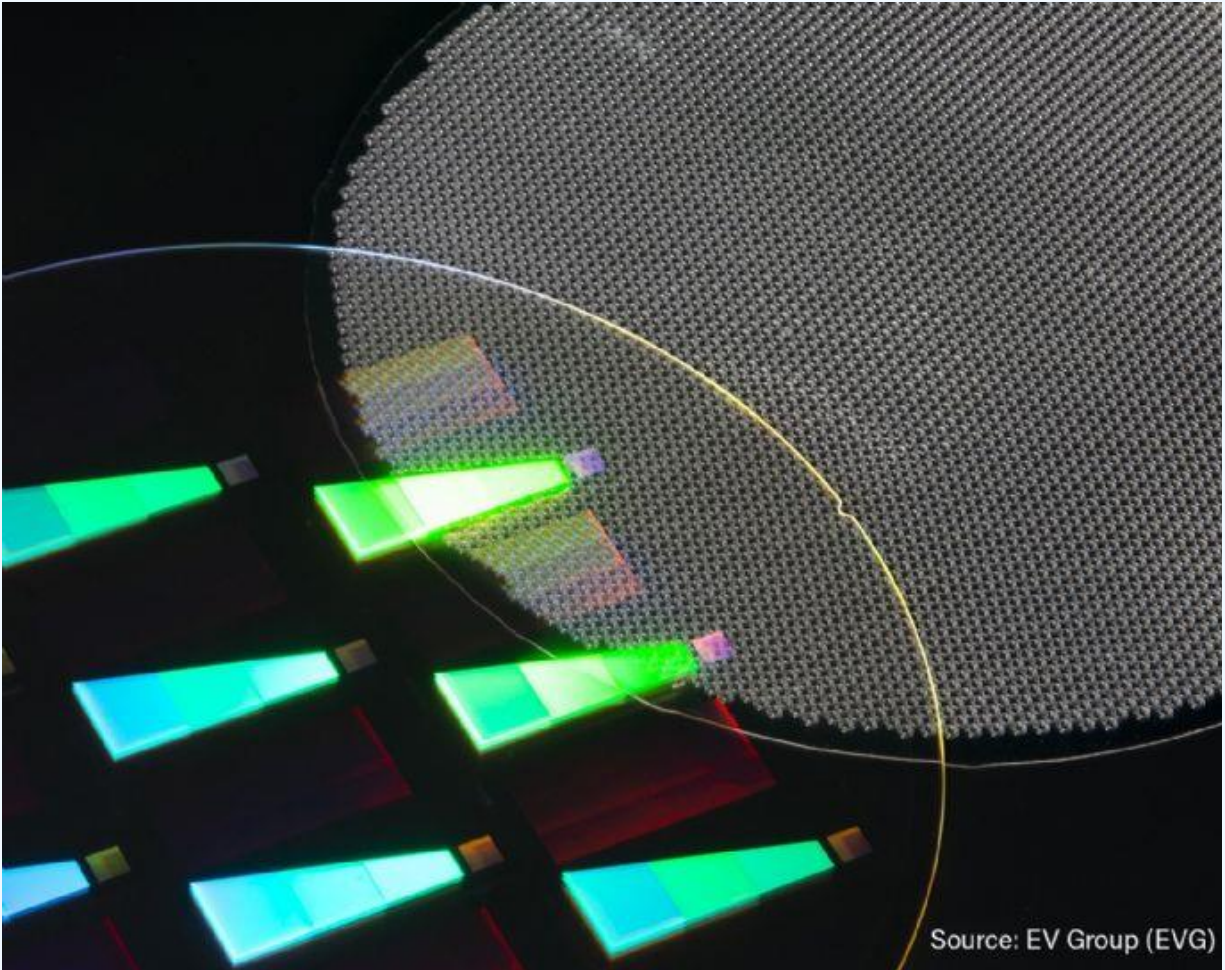
EVG@7300是EVG最先進的解決方案，可在單一平台上結合奈米壓印微影技術、透鏡壓鑄與透鏡堆疊（UV接合）等多重基於UV架構的製程



圖一_EVG@7300 SmartNIL®奈米壓印與晶圓級光學系統是具備多功能且先進的解決方案，可在單一平台上結合多重基於UV架構的製程。

台北，2022年1月19日 — 微機電系統（MEMS）、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備領導供應商EV Group（EVG），今天宣布推出EVG@7300自動化SmartNIL®奈米壓印與晶圓級光學系統。EVG7300是EVG最先進的解決方案，可在單一平台上結合如奈米壓印微影技術（NIL）、透鏡壓鑄與透鏡堆疊（UV接合）等多重基於UV架構的製程。這套隨時可供業界使用的多功能系統，旨在滿足涉及各種微型和奈米

圖案以及功能層堆疊等嶄新應用的先進研發與生產需求，包括晶圓級光學（WLO）、光學感測器與投影機、汽車照明、擴增實境頭戴式裝置使用的波導管、生物醫療設備、超穎透鏡（meta-lens）與超穎介面（meta-surface），以及光電學。EVG7300支援大至300毫米的晶圓尺寸，並具備高精度對準功能、先進製程控制與高製程產出量，滿足各種自由形式及高精度奈米和微型光學元件與設備的量產需求。



圖二_SmartNIL®結構化的擴增實境波導管和晶圓級微透鏡壓印展現了最新EVG®7300的多功能應用特性。

EV Group企業技術總監Thomas Glinsner博士表示：「EV Group憑藉累積超過20年的奈米壓印技術經驗，持續作為引領此關鍵領域的技術先驅，開發各種創新的解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。我們最新推出的奈米壓印解決方案系列產品EVG7300，將SmartNIL全域壓印技術及透鏡壓鑄和透鏡堆疊結合成一套頂尖的系統，具備市場上最精確的對準與製程參數控制，為我們客戶的產業研究與生產需求提供前所未有的彈性。」

」

EVG7300既可作為獨立工具，也可當作一個模組整合在EVG的HERCULES® NIL之中，作為UV-奈米壓印微影（UV-NIL）的全整合解決方案，其中還可增加如清洗、光阻塗層，以及烘烤或後處理等額外的預處理步驟，以最佳化特定製程的需求。這套系統透過結合對準階段的改善、高精度光學元件、多點間隙控制、非接觸式間隙量測與多點力控制，具領先業界最高可達300奈米的對準精度。EVG7300是具高度彈性的平台，提供三種不同的製程模式，包含透鏡壓鑄、透鏡堆疊與SmartNIL奈米壓印，並支援150毫米到300毫米晶圓的基板尺寸。模板與晶圓的快速裝載、快速對準的光學元件、高功率固化以及極小的工具佔用空間，使這套高效平台能夠滿足業界對嶄新WLO產品的製造需求。

產品供應時程

EVG現已開始接受各界對EVG7300自動化SmartNIL奈米壓印與晶圓級光學系統的訂單，並在位於公司總部的NILPhotonics® Competence技術中心提供產品展示。更多相關資訊，請瀏覽：<https://www.evgroup.com/products/nanoimprint-lithography/uv-nil-smartnil/evg-7300/>。

關於EV Group（EVG）

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商，主要產品包括晶圓鍵合、晶圓薄化、微影/奈米壓印微影技術（NIL）和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年，藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：www.EVGroup.com。

<https://tnews.cc/02/newscon1.asp?number=415337>